

我们很高兴推出 BEAM Engine Gen 2——这是从 Gen 1 迈出革命性的一步，为先进光刻应用提供更高精度、速度和可靠性。Gen 2 将标配于新系统，无需额外费用，也可作为 Gen 1 用户的升级选项。

第二代性能：超越前代型号，具有更高分辨率、更快曝光速度和增强的工艺灵活性。

先进的图案化能力：原生灰度和无缝拼接扩展了可实现的微纳结构范围，支持尖端器件制造。

运营效率：较低的维护需求意味着更长的运行时间和更低的总体拥有成本。

可互换镜头设计

- 实现 0.5 微米的分辨率。
- 支持高达 200 毫米²/分钟的高通量图形制作。

加速曝光

- 单次写入曝光最快可达250毫秒。

原生 256 级灰度支持

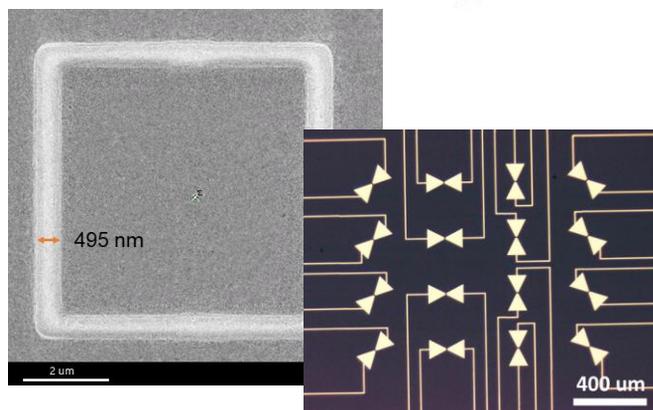
- 真实 8 位灰度光刻技术，用于高级2.5D 和3D微结构制造。

无缝拼接

- 梯形拼接，重叠率高达100%。

低维护

- 固态架构减少运动部件和磨损。
- 校准需求减少 80%，最大限度地减少停机时。



产品参数

	50x	20x	10x	5x
最小线宽 (um)	0.5	0.8	1.5	3
图形曝光速度 (mm ² /min)	3	15	60	200
曝光波长 (nm)	405 (标准), 365 和 385 (可选)			
灰度	256 级 (8 位)			